文章编号: 1001-3806(2006)06-0643-04

# 太赫茲自由电子激光器的成像原理及进展

#### 王 骐,迟 欣,李 琦

(哈尔滨工业大学 光电子技术研究所 可调谐激光技术国家级重点实验室,哈尔滨 150001)

摘要:主要介绍了几种自由电子激光器进行太赫兹成像的原理和方法,并给出了俄罗斯和韩国等研究人员最近一 两年的实验结果。指出现在太赫兹成像正向三维成像的方向发展。

**关键词**: 激光器;成像系统;太赫兹;小型;高能;自由电子激光器 中图分类号: TN248.6 **文献标识码**: A

maging theory and development of THz free electron lasers

WANGQi, CHIXin, LIQi

(National Key Laboratory of Tunable Laser Technology, Institute of Opto-Electronic, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: Several methods and theory of THz imaging as well as late results of the researchers in Russia and Korea are introduced At present, THz is being developed towards 3-D imaging

Key words: lasers; in aging systems; THz; compact; high-power; free electron laser

# 引 言

太赫兹波段是频率约在 0. 1THz~10THz内的电磁波,位于红外波段与微波波段的中间。由于大气对于太赫兹波段的强吸收,早期的科学家利用太赫兹波段来研究一些简单分子的振动和转动光谱特性。而近20年来,太赫兹技术已经发生了深刻的变革,随着新材料提供了高功率的发射源<sup>111</sup>,太赫兹被应用于越来越广的研究领域。

利用太赫兹波段进行成像是一门新兴的技术,无 论在生物<sup>[2]</sup>、医学<sup>[3]</sup>还是在人业中都有着广阔的应用 前景。根据太赫兹产生的激光源看太赫兹成像技术的 发展,目前主要有飞秒激光器、半导体激光器和自由电 子激光器等<sup>[4]</sup>,其中研究较多的太赫兹飞秒激光器体 积很大,但却可以产生脉宽皮秒以内、毫瓦量级的超短 脉冲<sup>[5.6]</sup>。太赫兹半导体激光器体积小、结构紧凑,一 般可以产生微瓦量级的辐射,量子级联半导体激光器 的出现使功率达到毫瓦量级<sup>[7.8]</sup>。自由电子激光器虽 然体积大,但是却可以产生平均功率数百瓦、峰值功率 几千瓦的太赫兹辐射,这为太赫兹成像带来很大好处, 如减轻探测系统复杂性、提高成像速率等。因此,作者 主要介绍一下利用小型和高功率自由电子激光器

作者简介:王 骐(1942-),男,教授、博导,主要从事激光 空间技术、X激光等方向的研究。

E-mail: qiwang@hit edu cn

收稿日期: 2005-10-17;收到修改稿日期: 2005-12-01

(free electron laser, FEL)成像的原理和发展现状。

# 自由电子激光器一般原理

一般类型的激光器所发射的激光波长受到电子所 处的原子能级限制,而在自由电子激光器中电子被从 原子中剥离出来,如图 1所示,然后通过加速器将它们 加速到高能。这些电子群聚,以 GeV 的能量通过长的 摆动器时产生自发辐射。



#### 图 1 自由电子激光器原理图<sup>[9]</sup>

如果电子束的相位空间与辐射场的相位空间匹配 得非常好的话,则辐射场与电子群聚相互作用会导致 电子束以周期等于波长的密度调制,由于电子密度调 制增强了辐射的相干性将引起辐射功率的增长,实现 了放大。通过改变加速器中的电子能量或摇摆器中的 磁场的强度,可以调节激光器的波长。这种系统造价 昂贵,但却可以产生连续的脉冲形式的发射和极高的 辐射功率。

# 2 自由电子激光器成像原理和技术

## 2.1 小型自由电子激光器二维扫描成像

韩国和俄罗斯在 2004年发表了利用小型自由电 子激光器进行太赫兹二维扫描成像的研究结果,成像 对象为微芯片、金属和非金属环以及植物叶片。

小型自由电子激光器产生太赫兹光束具有较好的 稳定性,图 2是 JEONG等人在冷却水温度 0.1 和环 境温度 1 的条件下测量得到的,它显示了脉冲能量 随时间的波动,测量中选取脉冲重复频率为 1Hz。从 图中可以看到太赫兹光束的极好的稳定性,计算得到 的脉冲能量的波动标准差小于 10%,并且能量的平均 值几乎不变。



图 2 太赫茲脉冲能量随时间的漂移<sup>[10]</sup> 所用小型自由电子激光器主要性能参数如表 1所 示。

	表 1	小型自由电子激光器性能参数		
波长 /µm	1	/	<b>脉宽</b> /ps	
100 ~ 120	0	0. 003	20	

JEONG等人对样品的二维扫描成像的系统的示 意图如图 3所示,太赫兹光束经过分束镜后分成两束, 其中一束作为参考光,另一束经样品后作为信号光传 入电脑。扫描系统和数据采集都是由电脑控制自动地 进行,由于是对此类样品成像的首次实验,也没有进行 样品的光谱分析,所以实验所用的波长可能没有调节 到最佳值。





JEONG等人首先对如图 4所示左侧的微芯片样 品进行了成像。相对于肉眼的观察,太赫兹成像具有 较大的动态量程,在所成像的黑暗区域经过放大也可 以看到物体的像。右图是对黑盒子里的金属环和硅做 成的环的成像,在图中可以清晰地看到两个环的轮廓, 经过放大,从所成的像中还可以看到硅环内的密度



图 4 利用太赫兹辐射对微芯片以及黑盒子里的金属环和硅环的成像<sup>[10]</sup>

的分布。利用太赫兹辐射的动态量程大的特点可以观察样品的内部情况,不用其它任何手段,太赫兹成像就 能达到 10<sup>5</sup> 的量程<sup>110</sup>。

JEONG等人还利用小型太赫茲自由电子激光对 银杏叶片进行了成像,如图 5所示,其中给出了可见光 的透射成像的对比。从图中可以很容易分辨出两种成 像的区别,这主要是由于水在两种频率的吸收系数不 同所致<sup>[10]</sup>。



图 5 对银杏叶片的成像<sup>[10]</sup>

#### 2 高能量自由电子激光器成像

2004年,俄罗斯研制了能够实现大功率太赫兹输 出的自由电子激光器,并进行了成像研究,其激光器主 要性能参数如表 2所示。

表 2	高能量自由电子激光器性能参数	
-----	----------------	--

平均功率 /W	波长 /µm	/	脉宽 /ps
200	120 ~ 180	0. 003	50

他们提出两种成像实验方案并进行了验证:利用 远 近红外转换器 (Fℝ-Nℝ converter, FNC)热成像方 法和热光探测仪干涉成像方法。

2 2 1 远 近红外转换器热成像 FNC热成像技术关键在于有将远红外转换成近红外的远 近红外转换器。 图 6是 FNC热成像原理示意图,太赫兹光束照射到能起到远 近红外转换作用的薄膜屏后,使其温度升高,



#### 图 6 FNC热成像方法示意图<sup>[11]</sup>

再利用热像仪来记录薄膜屏上的二维温度分布。实验 所用的热像仪在 2 6μm ~ 3.1μm 光谱范围在聚焦平 面上具有 128 ×128的灵敏度。热像仪在室温的灵敏 度是 0.03 ,帧频 30Hz~40Hz。 实验中采用碳纸作为远 近红外转换器,图 7a是 热像仪实物照片,图 7b是在远 近红外转换器前放置 一个漏有英文字母的铝板后所成的热像。由于热转换 速度有限,仪器的重复频率只能选择大约 10Hz。由于 吸收 10<sup>-2</sup>W /mm<sup>2</sup>能量就能使薄膜温度提高 0.1 ,而 俄罗斯大功率 FEL 的平均功率是 200W,所以利用它 进行实验已经足够了<sup>[11]</sup>。



图 7 热像仪和漏有英文字母的铝板太赫兹图像<sup>[11]</sup> a--热像仪 b-铝板的成像

222 热光探测仪干涉成像 另一种用来成像的主要技术是热光探测技术<sup>[12]</sup>(themo-optical detector, TOD),这种技术利用一种特殊的介质(如玻璃板),这种介质对于可见的探测光是透明的,而对于太赫兹辐射来说却是不透明的,并利用干涉方法获得图像。

当太赫茲辐射脉冲照射到样品表面时被样品吸收,在作用时间 r内样品光程的改变量发生如下变化:

$$S \quad \frac{\partial S}{\partial t} = \sum n(z, T(t)) dz$$
 (1)

式中,z是沿介质片厚度的坐标,T为环境温度,n为相应的折射率。

无论是热膨胀还是辐射部位折射率的变化都会使 光程发生改变。相应的改变量可以写为:

$$(x, y) = -Q(x, y)$$
(2)

式中,*Q(x, y)*是由于材料吸收能量密度的二维分布函数, 是(可见)探测光(即探针光)的波长。

 $[\text{cm}^{3}/\text{J}] = 2 (+ n) / c_{n}$  (3)

式中, = dn/dT, , , c<sub>p</sub>分别是样品的热膨胀系数,特 定 p压强下的密度和比定压热容。 对每种光学材料 来说都是常数。记录下位相的变化就可以很容易的求 出能量密度的分布。

成像实验中,利用从一个平面玻璃两表面反射光的干涉图样进行成像。CHERKASSKY等人采用一个



图 8 TOD方法的示意图以及利用数码相机进行的快照<sup>[12]</sup> 功率为 20mW 波长为 650mm 的半导体激光器作为系 统的平面波光源。实验装置如图 8所示,可见的探针 光扩束成平行光,照射到玻璃板上,在太赫兹光束曝光 前得到玻璃板前后面反射的干涉图样作为参考,然后 对玻璃板进行曝光(KnF激光产生的紫外辐射以及太 赫兹光束),由于能量吸收的热光效应会使干涉图样 发生变化。从后表面反射的光会发生位相的变化,变 化量遵循(2)式。

在每个点的位相改变 2 (x, y) = 2[ () -(0) 应该正比与玻璃板吸收的能量密度,表达式可 以写为.

E(x, y; t) = N(x, y; t)K (4) 式中, N(一般为正数但不一定是整数)是条纹的变 化,K是比例常数, $K = c_p/2(+n)$ 。 是探测光的 波长,其中分母中的 2是因为光两次经过了介质板。 如果光是倾斜的,还要考虑到倾斜角。

对于光学玻璃, K 4.0J/(cm<sup>2</sup>·条纹),如果选用 高热光转换常数 的材料会使灵敏度得到提高。另 外,扫描技术的发展使直接测量能量的密度分布成为 可能,这种实验的相应时间主要取决于曝光时间和冷 却方法。在没有任何冷却装置的情况下,使用短脉冲 辐射(40ns的 KrF激光)进行实验,在脉冲过后 1s后 图样恢复到了原来的图样。如果是长时间的曝光,当 热量传入到玻璃板的深处,相应的弛豫时间显然会增 加。如果有高热光系数的材料和足够好的冷却装置, 并把探测装置加上快门,成像的频率可能达到 10帧 / s

图 9中展示了分别利用 FNC和 TOD技术得到的 太赫兹光束横截面的成像。

从图中可以看到两种成像方法结果的相似,其轮 廓和利用热电转换器得到的轮廓一致。

CHER KA SSKY等人还用 TOD 技术实现了精细的 太赫兹成像,图 10是用铝片做成的一个遮光板,它的 外形是在环形轮廓中有一个"K字,所有这些的宽度 都约等于 3mm。把此遮光板正好放在玻璃板前,从而 忽略衍射的影响。在位相差没有超过 2 时,利用干 涉的方法可以得到没有失真的太赫兹成像,如图 11所 示。相位差大于 2 的话,得到的图像仍然很清楚,但 其中会混有干涉条纹,由于热量流失使图像随着时间



图9 利用远-近红外转换方法以及 TOD 方法对太赫兹光束横截面的成像<sup>[12]</sup>



图 10 铝制"K"型遮光板<sup>[12]</sup>



图 11 利用 TOD 方法成像随时间的变化<sup>[12]</sup>

的增长而模糊。由于激光能量符合高斯分布,作用到 环上的能量显然小于作用到字母"K"上的能量。可以 看出在环上的能量的传输慢于在字母上能量的传输, 图 11证实了这个结果。

## 3 结 论

主要介绍了韩国和俄罗斯在小型自由电子激光器 和大功率自由电子激光器进行太赫兹成像的原理和进 展。对于这一领域的研究,目前还不多,但由于自由电 子激光技术的提高,特别是其太赫兹输出能量是目前 所有太赫兹激光源中最高的,因此,很有发展前景。对 于其成像方法的研究还需进行深入细致的探索,现在 正在向三维成像上发展。

#### 参考文献

- [1] NEL G R. High power subpicosecond THz and R production [A]. Conference Digest of the 2004 Joint 29th International Conference on Infrared and Millimeter Waves and 12th International Conference on Terahertz Electronics [C] New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2004. 593 ~ 594.
- [2] DOR A A, GALLERANO G P, GDVENALE E et al THz radiation studies on biological systems at the ENEA FEL facility [J]. Infrared Physics and Technology, 2004, 45 (5 ~ 6): 339 ~ 347.
- [3] FHZOERALD A J, BERRY E, ZNOVEV N N et al An introduction
  6 medical imaging with coherent terahertz frequency radiation [J].
  Physics in Medicine and Biology, 2002, 47 (7): 67 ~ 84.
- FERCUSON B, ZHANG X Ch Materials for terahertz science and technology [J]. Physics, 2003, 32(5): 286 ~ 293 (in Chinese).
- [5] XU J Zh, ZHANG C L, ZHANG X Ch *et al* Recent progress in terahertz science and technology [J]. Progress in Natural Science, 2002, 12(10): 729 ~ 736.
- [6] ZHANG X C. Terahertz wave imaging: horizons and hurdles [J]. Physics in Medicine and Biology, 2002, 47 (21): 3667 ~ 3677.
- [7] TRED CUCCIA, KöHLER R, BELTRAM F et al Terahertz quantum cascade lasers [J]. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2004, 21 (2 ~ 4): 846 ~ 851.
- [8] CIIR N D S High-field electron-hole wavepacket dynamics and THz emission in semiconductor quantum wells [J]. Opt Commun, 1998, 148: 187 ~ 196.
- [9] L IW Sh Free electron laser [J]. Modem Physics, 2005, 17 (4): 27 ~ 28 (in Chinese).
- [10] JEONG Y U, CHA H J, PARK S H *et al* THz imaging by a wideband compact FEL [A]. Proceedings of the 2004 FEL Conference
   [C]. Trieste: Comitato Conferenze Elettra, 2004. 667 ~ 670.
- [11] CHERKASSKY V S, KNYAZEV B A, KUBAREV V V et al Inaging techniques for a high-power THz free electron laser [A]. Proceedings of International Conference IRMMW 2004/THz 2004 [C]. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2004. 567 ~568.
- [12] CHERKASSKY V S, KNYAZEV B A, KUBAREV V V et al maging techniques for a high-power THz free electron laser [J]. Physics Research, 2005, A543 (1): 102 ~ 109.